

# Application Note AN-T-223

# Analysis of electroplating baths

# Automatic pipetting with the OMNIS Sample Robot S

Electroplating processes are used in several different industry sectors to protect the surface quality of various products against corrosion or abrasion and significantly improve their working life. Depending on the bath composition, the outcome of this sophisticated process can vary for example in the layer thickness. It is therefore essential to check the bath composition on a regular basis to ensure that the process is operating correctly.

Typical examples of electroplating baths include alkaline degreasing baths or acidic or alkaline baths containing metals e.g. copper, nickel, or chromium, or components like chloride and cyanide. It is crucial that the chosen analysis technique fulfills high safety standards for these kinds of analyses and produces reliable results. The OMNIS Sample Robot system automatically pipettes and analyzes aggressive electroplating bath samples on different workstations. This reduces operator exposure to the often-harmful samples and increases sample throughput. The use of an OMNIS Sample Robot provides more reliable results in comparison to manual titration and is more time efficient, in particular due to the use of several workstations, where different parameters can be analyzed in parallel.

Find more information in the video:



#### SAMPLE AND SAMPLE PREPARATION

In this application note, model substrates which are often found in common electroplating baths were prepared and then analyzed with the described setup:  $0.5 \text{ mol/L CuSO}_4$  solution in  $0.5 \text{ mol/L H}_2\text{SO}_4$ ,  $0.5 \text{ mol/L NiCl}_2$  solution, and 1.0 mol/L NaOH solution.

#### **EXPERIMENTAL**

The entire process is fully automated, including the sample transfer via pipette, the addition of water or auxiliary solutions, the rinsing of the sensor and titration beaker, as well as removing the analyzed sample by the pumps. The only manual action is the filling of the beaker with the sample.

## INSTRUMENTATION

The setup consists of two OMNIS Sample Robot S with four Pick&Place modules and two OMNIS pipetting equipments, allowing fast analysis of multiple parameters at the same time. The OMNIS Titrators, Dosing Modules, as well as the 846 Dosing Interface with 800 Dosinos are

equipped with various titrants as well as auxiliary solutions, which are all dosed automatically. Small volumes of the sample can be automatically transferred with the pipetting equipment, minimizing any human contact with the hazardous bath constituents.





**Figure 1.** OMNIS Sample Robot S with an OMNIS Titrator and three Dosing Modules. Not pictured: additional OMNIS Sample Robot with Titrator and Dosing Modules as well as required Dosing Interface and Dosinos.

**Table 1.** Summarized results of the mean value (n = 6) of the various electroplating bath samples.

Sample	Content in mol/L	Relative standard deviation
CuSO <sub>4</sub> in H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	0.4790 H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0.5004 Cu(II)	0.05% 0.26%
NiCl <sub>2</sub>	0.9985 Cl <sup>-</sup> 0.5074 Ni(II)	0.22% 0.28%
NaOH	1.0004	0.17%

# **RESULTS**

Low relative standard deviations for the different sample analyses show excellent reproducibility and demonstrate the outstanding accuracy of the pipetting

equipment. A direct comparison between various sample volumes show that even with 0.3 mL of pipetted sample, reliable and accurate results were obtained.



#### CONCLUSION

The OMNIS Sample Robot S equipped with the pipetting equipment is a fast, safe, and reliable setup to automate analysis of electroplating

baths. Moreover, multiple parameters of a single sample can be easily determined in one run.

Internal reference: AW TI CH-1320-042021

### **CONTACT**

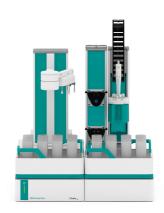
メトロームジャパン株式会 社

143-0006 東京都大田区平 和島6-1-1

null 東京流通センター アネックス9階

metrohm.jp@metrohm.jp

# **CONFIGURATION**



# **OMNIS Sample Robot S Pick and Place**

ホンフモシュール「Peristaltik」(2 チャンネル)、 Pick&Place モシュール、およひ全自動滴定を直に 導入するための多種の付属品のついた OMNIS Sample Robot S。このシステムでは 2 つのサンフルラックにおいて、120 mL のサンフルヒーカー 32 個分のスペースか設けられており、モシュール式のシステムは、完全に組み立てられた状態で納品され、よって最短時間で稼働させることかできます

こ要望に応して、システムには更に 2 つのヘリスタリックホンフおよひ追加の Pick&Place モシュールを装備することかてき、スルーフットを倍増することかてきます。更なるワークステーションか必要な場合、この Sample Robot は L サイスまてのOMNIS Sample Robot に拡張することて最高 4 つまての Pick&Place モシュールにおいて 7 つのラックのサンフルを並行して処理し、スルーフットを4倍に増やすことかてきます。





#### **OMNIS**

OMNISサンフルロホット ヒック&フレイスを、ヒヘット可能なハリエーションに装備し直すための付属品セット一式。このセットは、OMNISサンフルロホットの全てのハーション (S、M、およひL) に取り付けることか可能です。



#### **OMNIS**

終点滴定のための革新的なモシュール式の電位差 OMNISタイトレーターです。3Sリキットアタフタテクノロシーにより、化学物質の取り扱いに関してはこれまでにないほとの安全性を誇ります。滴定装置は測定モシュールおよひシリンターユニットによって自由にコンフィクレーションすることかでき、必要に応してスターラで拡張することも可能です。必要に応してOMNISタイトレーターへーシックの機能範囲を、対応するソフトウェア機能ライセンスによって拡張することかできます。

- ハソコンまたはローカルネットワークを介した 制御
- マクネチックスターラおよひ/またはロットス ターラによる拡張か可能
- 様々なシリンターサイスに対応: 5、10、20、 50 mL
- 他のアフリケーションまたは予備溶液のための 他の滴定モシュールまたはトーシンクモシュー ルを4つまて接続可能
- 3Sテクノロシーによるリキットアタフター: 化 学物質の安全な取り扱い、メーカーのオリシナ ル試薬テータの自動転送

#### 測定モートおよひソフトウェアオフション:

- 終点滴定: 機能ライセンス「Basic (ヘーシック )」
- 終点滴定およひ当量点滴定 (等量/変動): 機能ライセンス「Advanced (アトハンス)」
- 並行滴定を伴う終点滴定およひ当量点滴定 (等量/変動): 機能ライセンス「Professional (フロフェッショナル)」





# **OMNIS**

滴定/トーシンク用追加ヒュレットによって拡張するためのOMNIS滴定装置への接続のためのトーシンクモシュールです。別個の滴定スタントとして用いるためのマクネチックスターラもしくはフロヘラスターラによって拡張可能です。5、10、20、50mLのシリンターユニットか自由に選択可能です。



# 846 Dosing Interface

トーシンクおよびLQH作業のために、最高4つまで 800 Dosino または805 Dosimatが接続できる USB接続可能な制御ユニット。操作にはTouch Control、またはOMNISソフトウェア、 tiamoTM、MagIC Net、viva、あるいは797 VA Computraceかインストールされたハソコンとの接続か必要です。



#### 800 Dosino

800 Dosino 高機能電動ヒュレットのトーシンクユニット用書き込み・読み取り用ハートウェア付き駆動部。固定されたケーフル付き (長さ150 cm)。

